





図 3.3(c). κ-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu(N-とその Fourier 変換(下図)<sup>22,23)</sup>.

図 3.3(c). κ-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu(NCS)<sub>2</sub>の伝導面に垂直磁場を印加したときの磁気抵抗(上図)

Relative Intensity (a) 0 0.5 1.5 2.0 2.5 3.0 10 3.5 4.0 4.5 50 Area in  $\hat{k}$  space (a.u.) Relative Intensity (b) my m 0.5 Area In k space (a.u.) 1.0 1.5 0



図 3.4. マグネシュウムに関する磁化測定から得られた磁場の強さの逆数に関する Fourier 変換<sup>11)</sup>. (a) と (b) は Fourier 変換領域が異なる. それぞれ, 5.011T<  $H < 5.025T \ge 5.025T < H < 5.039T$ . 若干,領域をずらしただけで,波形が不安定になっている. Falicov-Stachoviak 理論 では許されない軌道に対応するピークは,例えば (b) の 1.255a.u. である. 矢印を添えておく.

図 3.5.  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu(NCS) の Fourier 変換(下図)<sup>12)</sup>.

77

図 3.5. κ-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu(NCS)<sub>2</sub>の伝導面に垂直磁場を印加したときの磁化(上図) とそ







0

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

-0.6

-0.7

0

図 3.6(b), (c). (b) v = 0.18 における磁場中のエネルギーバンド構造(上図). フィリングが 2/3のときのフェルミエネルギーが破線で記されている. (c) 図(b)の拡大図(下図). 但し、横 軸を h の逆数としている. 破線はフィリングが 2/3 のときのフェルミエネルギーである.





0.03 A (arb. unit) 0 0



図 3.7(b). Mの FTA (A(f)). 横軸は周波数 (f) である. Fourier 変換の領域は  $4 \le h^{-1} \le 40$ .





図 3.7(c). 周波数  $f_{\beta}, f_{2\beta}, f_{3\beta}$ に関する,  $M(h^{-1}) \ge M^{LK}(h^{-1})$ の FTA の磁場依存. 横軸は Fourier 変換の領域の中点  $h_c^{-1}$ である. 〇が  $A_j^{LK}(h_c^{-1})$ であり, ●が  $A_j(h_c^{-1})$ である. Fourier 変換領域の幅 2L は 21 図 3.8. v=0, フィリング 2/3 における $\beta$ 振動に関する  $M \ge M^{LK}$ の FTA の温度依存. ●が  $A_{\beta}(T)/A_{\beta}(0)$  である.実線は様々な  $m_{\beta}$ に対する  $A_{\beta}^{LK}(T)/A_{\beta}^{LK}(0)$  である. Fourier 変換の領域は  $14 \le h^{-1} \le 38$ .







図 3.9(b). Mの FTA (A(f)). 横軸は周波数 (f) である. Fourier 変換の領域は  $4 \le h^{-1} \le 60$ .





図 3.10. T = 0 における  $M(h^{-1})$  (左列) とそれに対応する Fourier 変換(右列). (a) と(d) が v = 0.12 でフィリング 2/3 であり, (b) と (e) が v = 0.18 でフィリング 13/18 であり, (c) と (f) が v = 0.22 でフィリング 5/6 である



M(h) (arb. unit)

0

図 3.11. T = 0 における様々な軌道 jに関する  $A_j^{FS}$  (左列) と  $A_j$  (右列)の磁場依存の比較. Fourier 変換領域の幅 2L は v = 0.04 のとき 21 であり, v = 0.12 と v = 0.18 のとき 24 であり, v = 0.22 のとき 27 である. 図 3.12. T = 0, 0.005, 0.01, 0.015 における  $M(h^{-1})$ . v = 0.22 である.

89









図 3.14.  $\kappa$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>Cu(NCS)<sub>2</sub>の伝導面に垂直磁場を印加したときの SdH 観測から得ら れたサイクロトロン有効質量の圧力依存<sup>17)</sup>. 〇がα軌道,  $\square$ がβ軌道に対応する有効質量  $m_{\alpha}, m_{\beta}$ .

91





図 4.1.  $\alpha$ -(BEDT-TTF)<sub>2</sub>KHg(SCN)<sub>4</sub>の結晶構造. (a) は結晶軸の c 軸方向から見た図である. 四角で囲まれた部分が a-b 面についての単位格子である.各辺がそれぞれ格子定数になる. (b) は b 軸方向からの図. (c) は a-c 面内の KHg(SCN)<sub>4</sub>分子の配向を示している.

図 4.2. 拡張 Hűckel 法から計算されたα-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>KHg(SCN)<sub>4</sub>のエネルギーバンド構造.





図 4.4. α-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>KHg(SCN)<sub>4</sub>の伝導面上に, 垂直磁場を印加した場合の伝導面方向 の電気抵抗の温度変化の測定結果<sup>30</sup>. 様々な磁場の値(1Tから13Tまで)に関して示してある.





図 4.5. α-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>KHg(SCN)<sub>4</sub>の伝導面上に,垂直磁場を印加した場合の伝導面方向 の電気抵抗(上側)と磁化(下側)の磁場変化の測定結果<sup>30)</sup>.非常に長いヒステリシス領域(約 7.5T から約 24T まで)が存在している.温度は 0.75K である.

97

図 4.6. 磁気抵抗におけるキンク磁場  $(H_A)$  の温度変化<sup>30)</sup>. 図 4.5と同様な測定である.









図 4.8. α-(BEDT-TTF)<sub>2</sub>KHg(SCN)<sub>4</sub>の帯磁率の温度変化<sup>34)</sup>. 伝導面に垂直磁場を与えた場 合の帯磁率(o)は温度に関して一定であるが、平行磁場を与えたの帯磁率(ロ)が約10Kで急激 に減少していることがわかる. △は粉末の試料による帯磁率である. △はoと口の中間的な振る





図 4.10. 図 4.9 の SdH 振動の周波数から予想される, SDW ネスティングにより再構成され たフェルミ面の形状<sup>38)</sup>. (a) は正常状態のフェルミ面. (b) は SDW ネスティングにおいて, 作り 出される軌道を示している. 一次元的なほとんど平行な開いたフェルミ面のネスティング後は, α<sub>1</sub> 軌道が重なり合っている. (c) は SDW 形成後のフェルミ面.



(C)





図 4.12. 弱磁場領域における, hの関数としての正常状態(N)とSDW状態(SDW)につ いてのそれぞれのエネルギー.h = 0で  $10^{-6}t$  程度の SDW 利得により SDW 状態が安定化されて いる. 両曲線の交点が矢印で記してある. 交点 h1, h2, ···, hAが複数の一次転移磁場である. 挿入









800 400 - EF 0 - 400 -800 Г X V (0,0) (π/a,0) (π/a,π/b) (0,π/5) (0,0)

meV

図 5.1. (TMTSF)<sub>2</sub>X の結晶構造.上図は結晶軸の a 軸に沿う方向から見た図.四角で囲まれ た部分が b-c 面内の単位格子であり、各辺がそれぞれ格子定数になる. 下図は b 軸方向からの図. a軸方向の格子間隔が矢印の長さである. (TMTSF)分子と陰イオンの配置される位置がわかる. 図内の距離を示す数字はÅの単位を持つ.

109



図 5.2. 拡張 Hűckel 法から計算された (TMTSF)<sub>2</sub>X, X=AsF<sub>6</sub> のエネルギーバンド構造<sup>48)</sup>.





-

8

• F

0 2F

.5

図 5.4. (a) X=ClO<sub>4</sub>の伝導面に垂直磁場を印加した場合の磁気抵抗の観測結果<sup>59)</sup>.磁場の強 さの逆数に関して SdH 振動的に振動している. 矢印が NM 相と FISDW 相の境界を示す. 5K 以上 では全磁場領域で NM 相である. (b) 二種類の磁場の領域 (NM 相と FISDW 相)の ROの FTA の温度変化<sup>59)</sup>. ■と▲が(△) NM 相での RO の FTA (RO の第2高調波成分の FTA) であり, ● (○) が FISDW 相での RO の FTA (RO の第2高調波成分の FTA).





図 5.5. X=ClO<sub>4</sub>の伝導面に垂直磁場を印加した場合における磁化<sup>55)</sup>. FISDW 相において RO が見えている(矢印で示す).しかしながら,NM 相では詳しく結果が示されていない.

図 5.6. 常圧下の X=NO<sub>3</sub> (SDW 相)の伝導面に,垂直磁場を印加した場合の磁気抵抗の観 測結果<sup>60)</sup>. 横軸は磁場の強さの逆数であり,様々な温度についての結果が示してある. 矢印から わかるように,短周期の振動 (RO) と長周期の振動 (LO) が存在していることがわかる. また, 短周期の  $f_{RO}$ と長周期の  $f_{LO}$ が MB によって結び付けられていることがわかる.



k<sub>x</sub>  $ClO_4$ 

k<sub>x</sub>

ky/





 $NO_3$ 

図 5.8. (a) 我々の計算による (TMTSF)<sub>2</sub>X のフェルミ面  $(t_b/t_a = 0.6, t_{b'}/t_a = 0.2)$ . 図中 の $Q_{\rm A} = (0, \pi/b) (Q_{\rm A} = (\pi/a, 0))$ は ClO<sub>4</sub> (NO<sub>3</sub>) についての AO の周期.  $Q_{\rm S}$ は  $(\pi/a, \pi/b)$  で ある. (b) (a) に各 AO ポテンシャルを導入した後のフェルミ面. AO ポテンシャルの大きさ V/ta は 0.2 である. 左側が ClO<sub>4</sub>,右側が NO<sub>3</sub>である.磁場中の電子の進行方向を矢印で記してある.



図 5.8(c). (c) (a) に各 AO ポテンシャルと SDW ネスティングを行った後のフェルミ面. 左 側が ClO<sub>4</sub>,右側が NO<sub>3</sub>である. SDW ギャップの大きさ $\Delta/t_a$ は 0.03 である. 破線は MB により 運動できる軌道であり、この軌道がROの起源となる. ClO4もNO3も、電子的な運動をする軌道 とホール的な運動をする軌道の2種類あることがわかる.また、実線で示されている小閉軌道が LOの起源である.磁場中の電子の進行方向を矢印で記してある.実線の四角がBZ.

SDW 状態 ( $\Delta = 0.03$ ) に関する FTA の  $A_{RO}$  と  $A_{LO}$ の磁場依存.



図 5.9. (a) と (b) は我々の計算結果 M(h<sup>-1</sup>). (a) が ClO<sub>4</sub>, (b) が NO<sub>3</sub>に対する結果である. それぞれ、上図が NM 状態 ( $\Delta = 0$ )、下図が SDW 状態 ( $\Delta = 0.03$ ) に対応する. (c) は (b) の





図 5.10. RO の FTA の温度依存. (a) ClO<sub>4</sub>, (b) NO<sub>3</sub>である. それぞれ Fourier 変換領域は (a) では  $86 \le h^{-1} \le 150$  (b) では  $60 \le h^{-1} \le 140$  である. 両方の図において,  $T_{SDW}$ 付近で FTA の急激な変化がある.

に対応する.

図 5.11(a). 磁場中のエネルギーバンド構造に対するフィリング1/2のときのフェルミエネル ギー.  $t_b/t_a = 0.6, t_{b'}/t_a = 0.1, V/t_a = 0.4$ である. エネルギーバンドは ClO<sub>4</sub>の NM 状態 ( $\Delta = 0$ )





 $ClO_4$ の NM 状態 ( $\Delta = 0$ ) に対応する.

図 5.11(a). 磁場中のエネルギーバンド構造.  $t_b/t_a = 0.6, t_{b'}/t_a = 0.1, V/t_a = 0.4$  である.



![](_page_25_Figure_0.jpeg)

![](_page_26_Figure_0.jpeg)

![](_page_27_Figure_0.jpeg)

![](_page_28_Figure_0.jpeg)

![](_page_29_Figure_0.jpeg)

NO<sub>3</sub>の SDW 状態( $\Delta = 0.03$ )に対応する.

![](_page_29_Figure_2.jpeg)

図 5.11(d). 磁場中のエネルギーバンド構造.  $t_b/t_a = 0.6, t_{b'}/t_a = 0.1, V/t_a = 0.4$  である.

![](_page_30_Figure_0.jpeg)

![](_page_31_Figure_0.jpeg)

図 5.13. X=ClO<sub>4</sub>に対する幾つかの温度における磁気抵抗(上段),磁化(中段),ホール抵抗(下段)<sup>71)</sup>.磁化について,2Kと4.5Kにおいて RO が約15T以上から観測されている(矢印で示してある).分かりにくいが,両者の鋸歯的波形が逆転していることに注意して欲しい.縦磁気抵抗( $\rho_{zz}$ )にも,2Kと4Kにおいて約15T以上から,周期的な振動である RO の存在がわかる(矢印で示してある).

図 5.14. X=ClO<sub>4</sub>に対する幾つかの温度における音波の測定結果<sup>56</sup>). 温度は上から順に 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 5K である. 3.5K と 2.5K を境として,位相が丁度半波長ずれていることがわかる. 矢印に注目して欲しい.波形の山と谷が逆転していることがわかる.横軸は磁場の強さの逆数で ある.

129

![](_page_31_Figure_4.jpeg)

3

2

1

0

8

U/VD

10<sup>3</sup>